## Yb 添加シリカファイバのフォトダークニング

(株)フジクラ光電子技術研究所光ファイバ技術研究部

荒井智史

### Photodarkening in Yb-Doped Silica Fibers

### **Tomofumi Arai** Fujikura Ltd. Optical Fiber Technology Department of Optics and Electronics Laboratory

1. はじめに

近年,様々な分野で利用されているファイバ レーザは,高いエネルギー効率やビーム品質, 小型軽量,メンテナンスの容易性などの優れた 利点を有する。特に,イッテルビウム(Yb) を添加したシリカガラスファイバを増幅媒体と するファイバレーザの出力パワーは,過去数年 間で急速に増加している。一方で,Ybファイ バレーザのさらなる高出力化のための克服すべ き課題の一つとして,Yb添加シリカファイバ への励起光の入射によって生じるフォトダーク ニングが知られている<sup>1)</sup>。Yb添加シリカファ イバのフォトダークニングは,ファイバレーザ の継時的な出力低下の原因となることから,フ ォトダークニング抑制のための対策が求められ ている。しかし,フォトダークニングの発現機

〒285-8550 千葉県佐倉市六崎 1440 TEL 043-484-2197 FAX 043-481-1210 E-mail:tomofumi.arai@jp.fujikura.com 構の詳細については、いまだ明らかになってい ないのが現状である。本稿では、Yb 添加シリ カファイバのフォトダークニングの原因を調査 するため、フォトダークニングの発現機構に関 係するとされている、Yb を添加したシリカガ ラス中に生成される欠陥について、いろいろな 測定手法で調査した結果について紹介する<sup>2</sup>。

### 2. フォトダークニングとは

フォトダークニングは、一般的には媒質の光 透過率が特定の波長の光照射により増加する現 象を指す。Yb添加シリカファイバのフォト ダークニングの場合は、波長 900~1000 nmの 励起光入射により増幅媒体となるファイバのコ ア部分における透過損失が顕著に増加する現象 として表れる。図1にYb添加シリカファイバ のコア部分への励起光入射により、透過損失ス ペクトルがどのように変化するかの典型例を示 す。励起光の入射条件は、波長 976 nm、パワー 約 400 mW、ファイバ条長 30 cm、入射 時間 100 分間とした。図1 において、点線と太線は



図1 励起光入射前後での透過損失スペクトルと損失 増加量

それぞれ励起光入射前(オリジナル)と励起光 入射によりフォトダークニングが生じた後の透 過損失スペクトルを示す。実線は,励起光入射 による損失増加量を示し,測定波長範囲内にお いては短波長側ほど損失増加が大きい。この励 起光入射による損失増加は,Ybファイバレー ザのレーザ出力光の波長域(一般的には1000 ~1100 nm)まで及ぶため,ファイバレーザの 出力パワーを低下させる原因となる。

Yb 添加シリカガラスのフォトダークニング は、水素添加処理により損失がほぼ照射前のレ ベルまで回復することなどから<sup>3)</sup>、特定の吸収 波長を有する不対電子を伴う種類の欠陥(カ ラーセンタ)の生成が関係していると考えられ ている<sup>4.5)</sup>。

### 3. 電子スピン共鳴 (ESR)

3.1 ESR による欠陥種の同定

フォトダークニングの際に生成される欠陥を 同定するために,被覆を除去した Al-Yb 共添 加シリカファイバの電子スピン共鳴(ESR)を 用いた欠陥分析を行った。測定試料は,オリジ ナルと励起光入射後のファイバを用いた。ESR 測定により観測されたファイバ中のカラーセン タの定量結果を表1に示す。オリジナル試料で は,Si-E'およびSi-E'のO原子一個がH原子 で置換された欠陥であるSi(H)-Eのみ観測 された。一方,励起光入射後のファイバにおい

表1 ESR 測定によるファイバ中のカラーセンタの定 量結果

ファイバ サンプル	スピン密度 (spins/g)				
	Si-E'	Si(H)-E'	Al-E'	Al-OHC	NBOHC
オリジナル	2.0x10 <sup>14</sup>	2.9x10 <sup>13</sup>	_	_	-
励起光 入射後	1.9x10 <sup>14</sup>	2.8x10 <sup>13</sup>	—	1.4x10 <sup>14</sup>	_
γ線 照射後	4.5x10 <sup>14</sup>	3.2x10 <sup>13</sup>	—	1.5x10 <sup>14</sup>	少量

※表中の横棒はシグナルが観測されなかったことを示す

ては、オリジナルと同程度のSi-E'とSi(H)-E' に加えて、多数のAl-OHCが観測された。Al-OHCは、酸素正孔センター(oxygen hole center)とAlが結合した欠陥である。オリジナル と励起光入射後の測定結果から、Si-E'および Si(H)-E'はファイバの線引き工程などの製造 プロセスで生成される欠陥であり、Al-OHC は 励起光入射により生成される欠陥であると考え られる。以上の結果から、フォトダークニング はAl-OHC の欠陥生成に起因することが示唆 される。

# 3.2 励起光入射およびγ線照射により生成される欠陥の比較

ファイバ試料を用いた測定は, 試料サイズや 準備可能な試料の量の制約により, 測定法によ っては測定精度に限界がある。もし, フォト ダークニングさせたバルクガラス試料が得られ れば, 測定の容易さや精度の面で非常に有利で ある。しかし, 直径数 mm あるファイバ母材 のコア部分を直径数 µm のファイバのコア部分 と同程度までフォトダークニングさせること は, 必要になる励起光パワーの大きさから現実 的でない。そこで, Yb 添加シリカガラスへの 励起光照射およびァ線照射により生成される欠 陥の類似性を検証するために, ァ線照射により 生成した試料中の欠陥について調べた。試料へ のァ線照射は, <sup>60</sup>Coを線源として室温・大気中 で行った。

図2に, Al-Yb 共添加シリカファイバのオ リジナル, 励起光入射後, γ線照射後(照射線)



図2 励起光入射後およびγ線照射後ファイバの透過 損失スペクトル

量2×104 R)の透過損失スペクトルを示す。 ここで、γ線照射後の透過損失スペクトルは、 比較のため縦軸を1/2倍して表示している。測 定波長域でほぼ同様の波長依存性を示している ことから、励起光入射およびγ線照射による可 視光領域での損失増加の主因となる欠陥は同一 種であることが示唆される。

次に, ESR 測定に用いた Al-Yb 共添加シリ カファイバ (オリジナル) にγ線照射 (照射線 量 2×104 R) したファイバ試料を用いて, ESR 測定による欠陥分析を行った。表1にファイバ 中のカラーセンタの定量結果を示す。オリジナ ルと比較して, Si-E'と Si (H) -E', NBOHC の 若干の増加に加えて,γ線照射によっても励起 光入射の場合と同程度の Al-OHC が生成され ることが分かった。

以上の結果から,γ線は励起光とエネルギー 領域が大きく異なるにも関わらず,Al-Yb共 添加シリカガラスの欠陥生成に関して励起光と 同様の作用を有していると考えられる。従っ て,γ線照射後の母材試料を分析することによ っても、フォトダークニングに関する知見が得 られることが期待される。

### 4. X線吸収微細構造(XAFS)

ファイバに添加された Yb 近傍の原子配置に ついて、X 線吸収微細構造(XAFS)測定によ り調べた。XAFS は、高輝度 X 線を用いて特 定の原子近傍に位置する原子までの距離や個数





を調べる方法であり、シリカガラスのような非 晶質物質にも適用が可能である。測定試料に は、内付け化学的気相堆積法(MCVD法)に より作製した、Yb添加シリカガラスファイバ 母材の Al-Yb 共添加コア部分のみをくり抜い たバルクガラス試料のオリジナルおよび?線照 射(2×10<sup>®</sup>R)した試料を用いた。また、比較 対象のため YbCl<sub>0</sub>を標準サンプルとして測定を 行った。

図3に、XAFS 測定により得られた Yb-Lm 吸収端のX線吸収端微細構造(XANES)スペ クトルをフーリエ変換して得られる動径分布関 数を示す。図の横軸と縦軸は、それぞれ Yb 原 子からの距離 r および距離 r に存在する近傍原 子の数密度を表しており、動径分布関数は Yb と最近接原子である O(YbCl<sub>3</sub>では Cl) との結 合に起因するピーク A. Yb と第2近接原子で あるSiまたはAlの結合に起因するピークB を有する。オリジナルとγ線照射後の動径分布 関数を比較すると、ピーク A, Bの距離 r に差 異はほとんど見られないが、ピークBの強度 がγ線照射により減少している。この結果は、 γ線照射により第2近接位置に位置する原子の 密度分布が減少したか. あるいは対称性が低下 したことを示しており、Ybの第2近接原子の 挙動がフォトダークニング機構に関係している 可能性を示唆している。

### 5. 紫外・可視領域の透過率測定

最後に, Al-Yb 共添加母材試料 (厚さ1



図4 γ線照射による Al-Yb 共添加母材の透過率減少 量の波長依存性

mm) への y 線照射による透過損失の変化につ いて述べる。図4に, γ線照射 (2×10<sup>®</sup>R) に よる透過率減少量の波長依存性を太線で示す。 透過率減少量は、紫外領域に最大を有するブ ロードなピークを有している。点線は、Al-OHC が 388 nm と 539 nm に、Al-E'が 302 nm に吸収波長をもつことから<sup>6)</sup>、透過率減少量の 波長依存性をこれらの吸収波長を中心とするガ ウス分布曲線で分解したものである。ESR 測 定において Al-E'は観測されていないという疑 問はあるものの、Al-E'による光吸収はほぼ紫 外領域のみであり、可視~近赤外領域における 損失増加には寄与しないことが分かる。一方. Al-OHC の吸収は可視~近赤外領域に広がって おり、Ybファイバレーザで実用上問題となる レーザ出力光波長帯における損失増加は. Al-OHC による光吸収が主因であることが分か

る。

### 6. まとめ

以上,励起光入射後およびγ線照射後におけ る Al-Yb 共添加シリカガラスおよびファイバ の ESR, XAFS,透過率の測定結果について述べ た。透過率測定で存在が示唆された Al-E'が ESR で観測されていない,Yb に関係する欠陥 が評価できていないなどの課題は残っているも のの,いずれの測定結果からも光照射およびγ 線照射による Al-OHC の生成が示唆されるこ とから,Yb 添加シリカファイバのフォトダー クニングは Al-OHC の光吸収が要因である可 能性について示せたと思う。今後,更なる評 価・分析により,フォトダークニングの発現機 構を明らかにできることを期待する。

#### 参考文献

- 1) J. J. Koponen, M. J. Soderlund, S. K. T. Tammela, H. Po, Proceedings of SPIE, 5990, 72–81 (2005).
- 2) T. Arai, K. Ichii, S. Tanigawa, M. Fujimaki, Optical Fiber Communication Conference, OWT 2 (2009).
- 3) M. Engholm and L. Norin, Proceedings of SPIE, 6873, 68731 E (2008).
- 4) K. E. Mattsson, S. N. Knudsen, B. Cadier, T. Robin, Proceedings of SPIE, 6873, 68731 C (2008).
- J. Koponen, M. Soderlund, H. J. Hoffman, D. A. V. Kliner, J. P. Koplow, M. Hotoleanu, Appl. Opt. 47, 1247–1256 (2008).
- 6) H. Hosono and H. Kawazoe, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 91, 395–399 (1994).